

Плазма ТМ 200-03

Установка плазмохимического травления органических полимеров
и удаления фоторезистивной маски



Технические характеристики:

Характеристика	Плазмохимическое травление кремния
Скорость травления, нм/мин (при температуре 270 °С)	3000
Максимальная мощность генератора, Вт	3000
Величина предельного вакуума, Па	Не хуже 2 Па
Нагреваемый рабочий стол, °С	до 270
Мощность потребления, кВт	16
Газовая система	В соответствии с требованиями заказчика

- Система загрузки: шлюзовая, шлюзовая из кассеты, SMIF-контейнер
- Обработка пластин Ø 76, 100, 150, 200, 300 мм
- Источник плазмы собственной разработки
- Встраивание в чистую комнату
- Отсутствие ионной бомбардировки во время процесса
- Отсутствие внесенного заряда на основе измерения смещения CV-характеристики
- Возможность реализации режимов удаления фоторезиста с химически активными радикалами
- Система резистивного нагрева подложкодержателя с максимальной температурой нагрева 270 °С
- Габариты (ШхГхВ) не более 1900x2850x2000 мм

